(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年1 月19 日 (19.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/006721 A1

(51) 国際特許分類:
G11B 5/84 (2006.01) *B24B 37/00* (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/013219

(22) 国際出願日: 2005 年7 月12 日 (12.07.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-204852 2004 年7 月12 日 (12.07.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 昭和電工株式会社 (SHOWA DENKO K.K.) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目１３番９号 Tokyo (JP). 山口精研工業株式会社 (YAMAGUCHI SEIKEN KOGYO K.K.) [JP/JP]; 〒4580801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後１５３番地 Aichi (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 二郎 (YAMADA, Jiro) [JP/JP]; 〒3996461 長野県塩尻市大字宗賀１番地 昭和電工株式会社 塩尻生産・技術統括部内 Nagano (JP). 神田 恵 (KANDA, Megumi) [JP/JP]; 〒4580801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後１５３番地 山口精研工業株式会社内 Aichi (JP). 林 良樹 (HAYASHI, Yoshiki) [JP/JP]; 〒4580801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後１５３番地 山口精研工業株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** TEXTURING PROCESSING COMPOSITION

(54) 発明の名称: テクスチャリング加工用組成物

(57) **Abstract:** A composition of high processing rate that is capable of not only decreasing the post-texturing average surface roughness (Ra) of a glass-made magnetic disk surface and aluminum-made magnetic disk underlayer and forming minute texturing striation but also removing “grinding traces” and “grinding scratch” appearing on the underlayer and surface which are attributed to substrate grinding operation. There is provided a texturing processing composition used for texturing processing of an aluminum-made magnetic disk underlayer or glass-made magnetic disk surface, which composition comprises diamond nanoparticles of ≧ 150 m²/g specific surface area (A), a C₁₀-C₂₂ fatty acid or fatty acid metal salt (B), and an organic amine compound (C).

(57) 要約: アルミ製磁気ディスクの下地層、ガラス製磁気ディスク表面のテクスチャリング後平均表面粗さ（Ｒａ）を小さくし、かつ微細なテクスチャリング条痕を形成すると同時に、下地層や表面に存在するサブストレート研磨工程に起因する「研磨痕」や「研磨スクラッチ」を除去することのできる高加工レートの組成物を提供する。アルミ製磁気ディスクの下地層またはガラス製磁気ディスクの表面をテクスチャリング加工するためのテクスチャリング加工用組成物であり、（Ａ）比表面積が１５０m^2／ｇ以上のナノダイヤモンド粒子、（Ｂ）炭素数が１０～２２の脂肪酸または脂肪酸金属塩、（Ｃ）有機アミン化合物を含む。

WO 2006/006721 A1